JA06-021032 AZ

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出頭公開番号

特開平6-21032

(43)公開日 平成6年(1994)1月28日

技術表示箇所

(51)IntCL⁵

識別記号

厅内整理番号

H 0 1 L 21/304 21/302

3 4 I D 8728-4M

H O 1 L 21/60

N 8518-4M

3 0 1 D 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出頭番号

特類平4-173990

(22)出願日

平成4年(1992)7月1日

(71)出顧人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 森道 勇

大阪府門其市大字門其1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72) 発明者 岩井 哲博

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

座業株式会社内

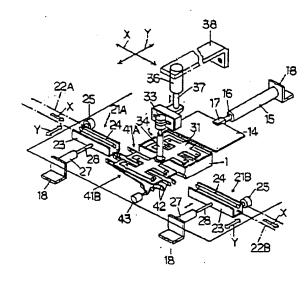
(74)代理人 弁理士 小鍛冶 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 基板のブラズマクリーニング装置

(57)【要約】

【目的】 基板のプラズマクリーニングを行うケーシングに、迅速に基板を出し入れできるプラズマクリーニング装置。

【構成】 ワイヤボンディングを行うのに先立って基板 10のクリーニングを行うプラズマクリーニング装置において、基板10をコンベア41からプラズマクリーニングを行うケーシング1に移送する動作と、プラズマクリーニングが完了した基板10をケーシング1からコンベア41へ移送する動作を一動作で行える出し入れ手段31~34を設けることにより、出し入れに要する時間を大巾に短縮する。



1 ケーシング

31 出し入れ平陸

14 カバー体

33 出し入れ手段

15 期間平段

94 出し入れ手段

【特許請求の範囲】

【請求項1】高電圧が印加される電極を備えたケーシン グと、このケーシングにプラズマ放電ガスを供給する放 電ガス供給部と、このケーシングの開口部を開閉するカ バー体と、このカバー体の開閉手段と、基板を搬送する コンペアと、基板を真空吸着する吸着パッドを備えこの コンベア上の基板を前記ケーシングに移送する動作とこ のケーシングの基板を前記コンベア上へ移送する動作を 一動作で同時に行う基板の出し入れ手段とを備えたこと を特徴とする基板のプラズマクリーニング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は基板のアラズマクリーニ ング装置に係り、詳しくは、半導体チップが搭載される **基板をプラズマクリーニング用ケーシングに作業性よく** 出し入れできる基板のプラズマクリーニング装置に関す る.

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造工程において、基 イヤで接続することが行われる。このようなワイヤボン ディング工程において、チップや基板の電極に不純物が 付着していると、ワイヤを電極にしっかりボンディング することはできない。この不純物としては、作業者が基 板を手で取り扱った場合に付着する手脂、空気中に浮遊 するガス化したオイル、電極表面に自然形成される酸化 膜、空気中の酸素やチッソなどのガス吸着膜等がある。 【0003】このため本出願人は、ワイヤボンディング に失立ってプラズマ手段により基板をクリーニングする 装置を先に提案した(特開平3-159143号公 報)。このものは特に同公報の第1図及び第2図に示さ れるように、コンベヤ17(符号は同公報援用、以下 同)で搬送されてきた基板20を、受け返し手段21に より一枚づつ報置部10に移載しながら、この截置部1 0をケーシング1内にピッチ送りして収納し、蓋部材1 1で開口部2を遮蔽した後、ケーシング1内にプラズマ を発生させて基板20の表面をクリーニングし、クリー ニングが終了したならば、上述と逆動作を行って基板2 0を一枚づつコンベヤ18に受け渡して次工程へ送るよ うになっていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 手段は、載置部10をケーシング1内へ前進させながら 受け渡し手段21によりコンベヤ17上の巫板20を載 置部10に移栽し、またプラズマクリーニングが終了し たならば、載置部10をケーシング1から引出しながら 差板20を載置部10からコンベヤ18に移載するよう になっていたため、基板20のケーシング1に対する出 し入れのために多大な時間を要し、作業能率があがらな い問題点があった。

【0005】そこで本発明は、基板をケーシングに出し 入れするのに要する時間を大巾に短縮できるプラズマク リーニング装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】このために本発明は、コ ンペア上の基板のケーシングへの移送と、ケーシングか らコンペアへの移送を一動作で同時に行える基板の出し 入れ手段を構成した。

[0007]

10 【作用】上記構成によれば、コンベア上の基板をケーシ ングに移送する動作と、ケーシングからコンベアに移送 する動作を一動作で同時に行えるので、基板をケーシン グに出し入れするのに要する時間を大巾に短縮できる。 [0008]

【実施例】次に、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。

【0009】図1は基板のプラズマクリーニング装置の 全体斜視図、図2は側面図である。図1において、1は 箱形のケーシングであって、 図2に示すようにその内部 板に搭載された半導体チップの電極と基板の電極とをワ 20 にはプレート状の軟置部2が配設されている。この載置 部2はシャフト3に支持されており、 このシャフト3は 高電圧を発生する電源4に接続されている。 またケーシ ング1は導電材から成り、アース線7でアースされてい る、またケーシング1にはパイプ8を通して放電ガス供 給部30からArガスなどのアラズマ放電用ガスが供給 される。9は開閉バルブである。

【0010】 載置部2及びシャフト3は薄電材から成っ ており、高電圧を印加すると、ケーシング 1 内でプラズ マが発生する。すなわち執置部2は放電用電極を兼務し 30 ている。シャフト3はシリンダ5のロッド6に支持され ており、ロッド6を突没させると載置部2は昇降する。 11はケーシング1に連結された排気管、12は開閉バ ルブであり、真空ポンプ19を駆動することによりケー シング1内のガスを排気する。

【0011】図1及び図2において、ケーシング1の上 面は開口部13となっている、14はこの開口部13を 開閉するカバー体であって、開閉手段としてのシリンダ 15のロッド16に固若子17を介して結合されてい る。18はシリンダ15の固定ブラケットである。した がってシリンダ15のロッド16を突没させると、カバ 一体14は開口部13に対してY方向に前進後退し、 開 口部13を開閉する。勿論カバー体は回転動作等をして 開口部13を開閉するものでもよい。

【0012】図1において、21Aは第1のコンベアで あって、コンベア22Aにより搬送されてきた基板10 をケーシング1の前部に設けられた第2のコンベア41 (41A, 41B)へ搬送するものであり、フレーム2 3に無端回動ベルト24を配設して構成されている。フ レーム23にはシリンダ27のロッド28が結合されて 50 おり、ロッド28が突没すると、コンベア21Aは基板

10の搬送方向Xと直交するY方向に水平移動する。2 5はベルト24の駆動用モータである。21Bは第1の コンベア21Aと反対側に設けられた第3のコンベアで あって、ケーシング1内でクリーニングされた基板10 をコンベア22Bへ搬出するものである。この第3のコ ンベア21日の構成は第1のコンベア21Aと同じであ り、同一構成部品には同一符号を付すことによりその説 明を省略する。

【0013】第2のコンベア41A. 41Bは2個並設 ている。前記シリンダ27のロッド28が突出すると、 前記第1のコンベア21A及び第3のコンベア21Bは 一方のコンペア41Aと同一直線上に位置して、コンペ ア21Aからコンペア41A、あるいはコンペア41A からコンベア21Bへの基板10の搬送が可能となり (図3実線参照)、またロッド28が引き込むと、コン ベア21Aからコンベア41B及びコンベア41Bから コンベア21Bへの基板10の搬送が可能となる(図3 類線参照)。

【0014】次に、図1及び図2を参照しながら、基板 20 10をケーシング1内に収納し、またケーシング1から 取り出す出し入れ手段を説明する。31はくし歯形のプ レートであって、延板10を真空吸着してピックアップ するピックアップ手段としての吸着パッド32を複数個 備えており、本実施例では4枚の基板10を同時に真空 吸着する。なお吸着バッド32の真空吸引系は図が繁雑 になるので省略する。このプレート31の中央部はモー タ33の回転軸34に固着されており、モータ33が駆 動するとプレート31は水平回転する。

【0015】モータ33は支持板35に固若されてお り、支持板35は垂直なシリンダ36のロッド37に結 合されている。したがってロッド37が突没すると、モ ータ33やプレート31は上下動する。シリンダ36は ブラケット38に固着されている。したがって前記構成 部品31~36は、芸板10の出し入れ手段を構成して いる。

【0016】本装置は上記のような構成より成り、次に 図4及び図5を参照しながら動作を説明する。図4 (a) に示すように、第1のコンベア21Aにより第2 のコンベア41A, 41B上に基板10が搬送されてく 40 ると、シリング36のロッド37が突出することによ り、プレート31は下降して吸着パッド32によりコン ベア41A,41B上の2枚の基板10を吸着し、次に ロッド37が引き込むことにより、基板10はビックア ップされる。

【0017】次に図4(b)に示すように、モータ33 が駆動してプレート31は180° θ A方向に回転し、 基板10をケーシング1の直上へ移送する。またシリン ダ5(図2参照)のロッド6が突出し、載置部2は上昇 する。そこでシリンダ36のロッド37が突出すること 50 あり、このように吸着パッド32の数を増やすことによ

により、基板10は載置部2上に若地し、そこで吸着バ ッド32の真空吸着状態を解除する(図4(b)鎖級参 照).このようにして基板10が載置部2に移載された ならば、ロッド37が引き込んでプレート31は上昇位 置へ退去するとともに、シリンダ5のロッド6が引き込 んで戦置部2は下降し、またシリンダ15のロッド16 が突出することにより、カバー体14は前進して開口部 13を遮蔽する (図4 (c) 参照).

【0018】以上のようにして2枚の基板10は同時に されており、無端回動ベルト42とモータ43から成っ 10 ケーシング1内に収納される。次に図2において、ポン プ19を駆動してケーシング1内の空気を排気した後、 パイプ8を通してArガスなどのプラズマ放電用ガスが ケーシング1内に供給される。次に電源4が駆動して戦 置部2に高電圧が印加されることにより、ケーシング1 内にプラズマが発生し、Arガス分子、Arイオン、マ イナス電子などが基板10の表面に衝突してその表面が クリーニングされる.

> 【0019】クリーニングが終了したならば、パイプ1 1を通してケーシング1内のガスを排気して常圧に戻す とともに、シリンダ15のロッド16が引き込んでカバ 一体14は開く.次に、図5(a)に示すように、シリ ング5のロッド6が突出して報置部2は上昇する。そこ でシリンダ36のロッド37が突出して右側の2個の吸 若パッド32は血道部2上の2枚の基板10をピックア ップする。このとき、コンベア41A, 41 B上には次 の基板10がすでに搬送されており、左側の2個の吸着 パッド32はコンベア41A,41B上の基板10をピ ックアップする、次にモータ33が駆動して、プレート 31は上記の場合と逆方向Bに180°回転し(図5 (b)参照)、次にシリンダ36のロッド37が突出し てプレート31は下降し、左側の吸着パッド32はクリ ーニング済の2枚の基板10をコンベア41A, 41B 上に移載するとともに、右側の吸着バッド32は新たな 2枚の基板10を数置部2に移載する。次いで図4 (c)に示す場合と同様にカバー体14が前進してケー シング1の開口部13を塞ぎ、上述の動作が繰り返され る。またコンベア41A、41B上に移載されたクリー ニング済の基板10は第3のコンベア21Bへ搬送さ れ、更にコンペア22Bにより次の工程へ搬出される。 【0020】このように本手段は、プレート31の18 O*の回転動作により、コンベア41A, 41B上の基 板10をケーシング1上へ移送する動作と、ケーシング 1内のクリーニング済の基板10をコンベア41A, 4 1 B上へ移送する動作を一動作で同時に行うようにして いるので、ケーシング1に対する基板10の出し入れに 要する時間を大巾に短縮できる。なお本実施例では、2 枚の基板10を同時に出し入れするものであるが、プレ

ート31に設けられる吸着パッド32の数を増やせば、

3枚以上の基板10を同時に出し入れすることも可能で

り、より多数枚の基板10を同時にケーシング1に出し 入れするようにして、出し入れに要する時間を更に短縮 することができる。また本実施例では、プレート31を ターンテーブルとし、水平回転運動により基板10をケ ーシング1に出し入れするようにしているが、直線運動 等により基板10を出し入れするようにしてもよく、要 は基板のケーシングに対する出し入れを一動作で同時に できるようにすればよい。

[0021]

【発明の効果】本発明は、基板をコンベアからケーシン 10 工程図 グへ移送する助作と、ケーシングからコンペアへ移送す る動作を一動作で行うようにしているので、ケーシング に対する基板の出し入れに要する時間を大巾に短縮し、 多数枚の基板をプラズマクリーニング処理するのに要す る全体時間を著しく短縮して、作業能率を向上すること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るプラズマクリーニング 装置の斜視図

【図2】本発明の一実施例に係るプラズマクリーニング 20 装置の側面図

【図3】本発明の一実施例に係るプラズマクリーニング 装置の基板の搬送コンベアの平面図

【図4】(a)本発明の一実施例に係るアラズマクリー ニングの工程図

- (b) 本発明の一実施例に係るプラズマクリーニングの 工程図
- (c)本発明の一実施例に係るプラズマクリーニングの 工程図

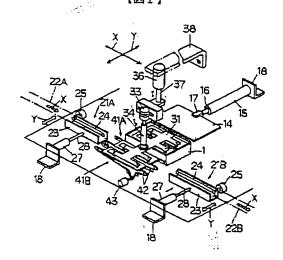
【図5】(a)本発明の一実施例に係るアラズマクリー ニングの工程図

(b) 本発明の一実施例に係るプラズマクリーニングの

【符号の説明】

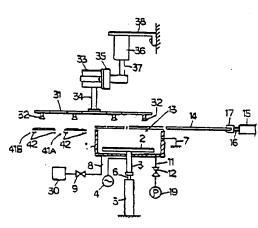
- 1 ケーシング
- 10 基板
- 13 開口部
- 14 カバー体
- 15 開閉手段
- 30 放電ガス供給部
- 31 出し入れ手段
- 32 出し入れ手段(吸着パッド)
 - 33 出し入れ手段
 - 34 出し入れ手段
 - 41 コンベア

【図1】



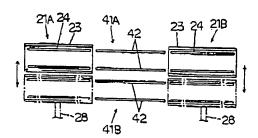
- 31 出し入れ手段
- 3 3 出し入れ不改
- 15 開開手段
- 34 出し入れ手段

[図2]

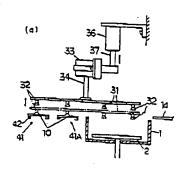


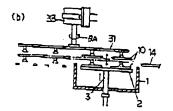
- 数量倍(質格)
- 放電ガス供給部
- 出し入れ手段(受害パッド)

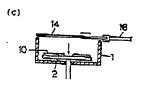
【図3】



[図4]



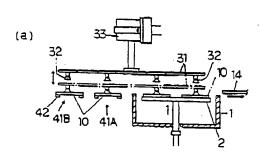


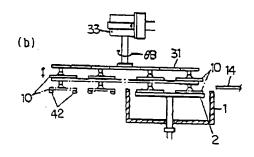


10 24

41 コンベア

【図5】





a lower case (11b), said upper case (11a) being openable from and closeable to said lower case (11b);

្នុម១១ ប្រជាជាធិក

opening and closing means (13) for said upper case (11a);

support means (15) for supporting said substrate (10), said support means (15) being disposed within said lower case (11b) and provided with a guide portion (37) for said substrate (10);

a power supply (16) for applying voltage to said support means (15) to generate plasma; and

feeding means (7) for feeding said substrate (10) on said support means (15) from said vacuum casing (11) to a substrate guide (21) disposed aside of said vacuum casing (11),

wherein said feeding means (7) includes: a pusher feeder (30) for pushing and feeding said substrate (10) while abutting against a trailing end of said substrate (10) on said support means (15) in a state in which said upper case (11a) is raised and opened; and driving means (31, 32, 33) for moving said pusher feeder (30) forward and backward.

Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-21032

includes only one claim. The Claim 1 reads as follows in English. The numerals placed between the parentheses are added by us for your reference.

- 1. A plasma cleaning apparatus for a substrate, comprising:
- a casing (1) having an electrode (2, 3) to which high-voltage is applied;
- a discharge gas source (30) for supplying said casing (1) with a plasma discharge gas;
- a cover member (14) for opening and closing an opening (13) of said casing (1);

opening and closing means (15) for said cover member (14);

a conveyer (41A, 41B) for conveying said substrate (10); and

means (31, 33) provided with suction pads (32) to attract said substrate (10) with the aid of vacuum for taking said substrate in and out, wherein said means (31, 33) simultaneously performs an operation for transporting a substrate (10) on said conveyer (41A, 41B) into said casing (1) and an operation for transporting a substrate (10) in said casing (1) onto said conveyer (41A, 41B) in a single action.

If you need any further information, please do not hesitate to contact us.

Very truly yours,

OKABE

International Patent Office

Seiichiro Takahashi

ST